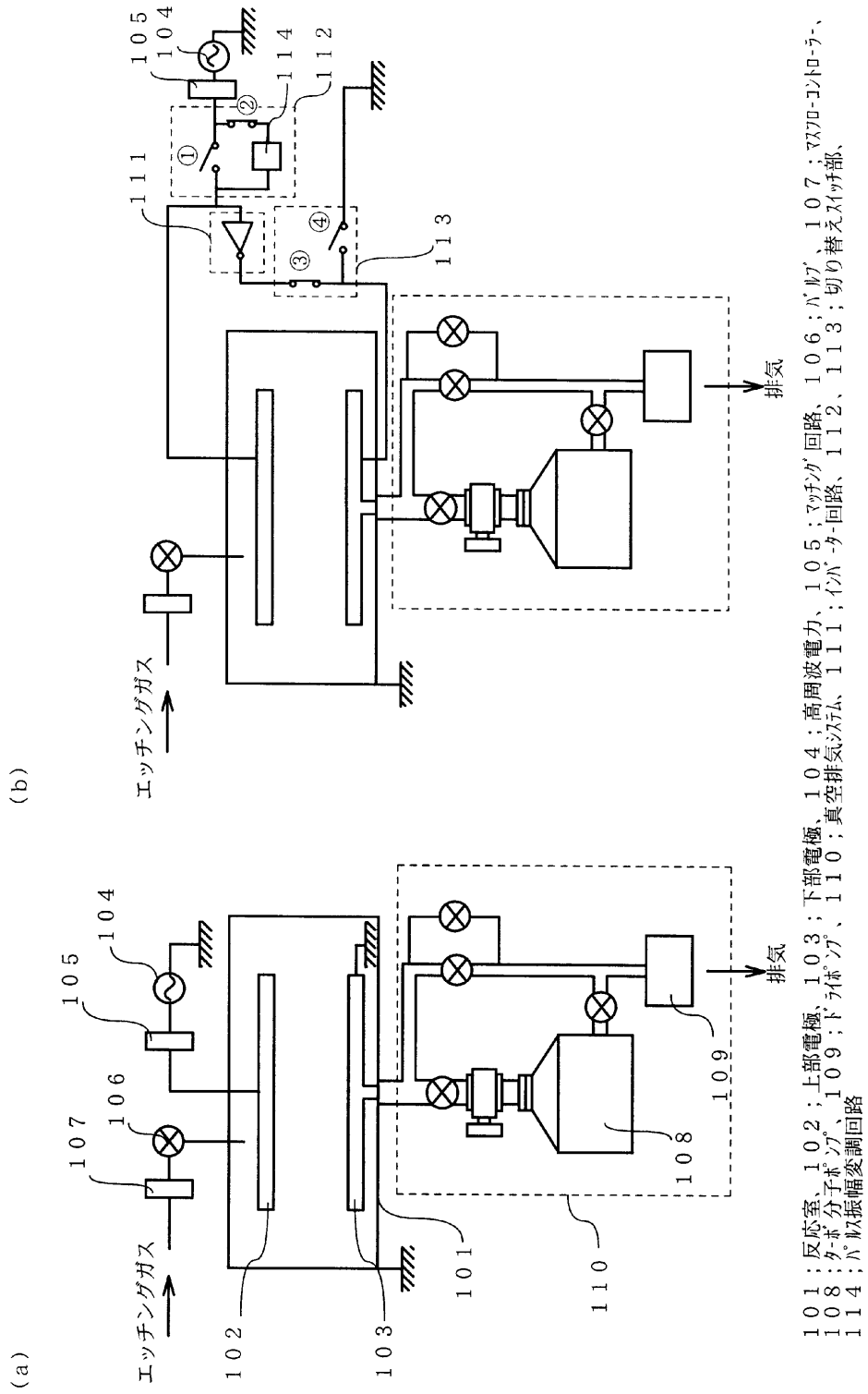
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成19年5月24日(2007.5.24)

【公開番号】特開2001-271170(P2001-271170A)
【公開日】平成13年10月2日(2001.10.2)
【出願番号】特願2000-87474(P2000-87474)
【国際特許分類】
Ｃ２３Ｃ　16/509　(2006.01)
Ｃ２３Ｃ　16/44　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/31　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/3065　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ２３Ｃ　16/509
Ｃ２３Ｃ　16/44　Ｊ
Ｈ０１Ｌ　21/31　Ｂ
Ｈ０１Ｌ　21/302　１０１Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成19年3月14日(2007.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
平行平板形プラズマＣＶＤ装置において、
高周波電源と上部電極および下部電極間に、マッチング回路と、第一の切り替えスイッチと、パルス振幅変調回路とを有し、
前記第一の切り替えスイッチと下部電極間に、インバーター回路と、第二の切り替えスイッチと、接地用の配線と、を有することを特徴とする平行平板形プラズマＣＶＤ装置。
【請求項２】
請求項１において、前記上部電極は、前記第一の切り替えスイッチを切り替えることにより、前記パルス振幅変調回路を通じてあるいは前記パルス振幅変調回路を通じずに、前記高周波電源と接続できることを特徴とする平行平板形プラズマＣＶＤ装置。
【請求項３】
請求項１において、前記下部電極は、前記第一の切り替えスイッチおよび第二の切り替えスイッチを切り替えることにより、前記パルス振幅変調回路および前記インバーター回路を通じて前記高周波電源と接続でき、前記第二の切り替えスイッチを切り替えることにより、前記接地用の配線と接続できることを特徴とする平行平板形プラズマＣＶＤ装置。
【請求項４】
請求項１乃至３のいずれか一項の平行平板形プラズマＣＶＤ装置のドライクリーニング法であって、
前記上部電極に、前記第一の切り替えスイッチを切り替えることによって前記パルス振幅変調回路を通じてパルス振幅変調された高周波電圧を印加し、
前記下部電極に、前記第一の切り替えスイッチを切り替えることによって前記パルス振幅変調回路を通じてパルス振幅変調された高周波電圧であって、前記第二の切り替えスイッチを切り替えることにより前記インバーター回路を通じて前記上部電極に対して位相が１８０°異なった高周波電圧を印加することを特徴とするドライクリーニングの方法。

【請求項５】
請求項４において、前記パルス振幅変調回路はパルス振幅変調するための信号波のパルス間隔を任意に選択できることを特徴とするドライクリーニングの方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１】



101；反応室、102；上部電極、103；下部電極、104；高周波電力、105；ﾏｯﾁﾝｸﾞ回路、106；ﾊﾞﾙﾌﾞ、107；ﾏｽﾌﾛｺﾝﾄﾛｰﾗｰ、
108；ﾀｰﾎﾞ分子ﾎﾟﾝﾌﾟ、109；ﾄﾞﾗｲﾎﾟﾝﾌﾟ、110；真空排気ｼｽﾃﾑ、111；ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ回路、112、113；切り替えｽｲｯﾁ部、
114；ﾊﾟﾙｽ振幅変調回路